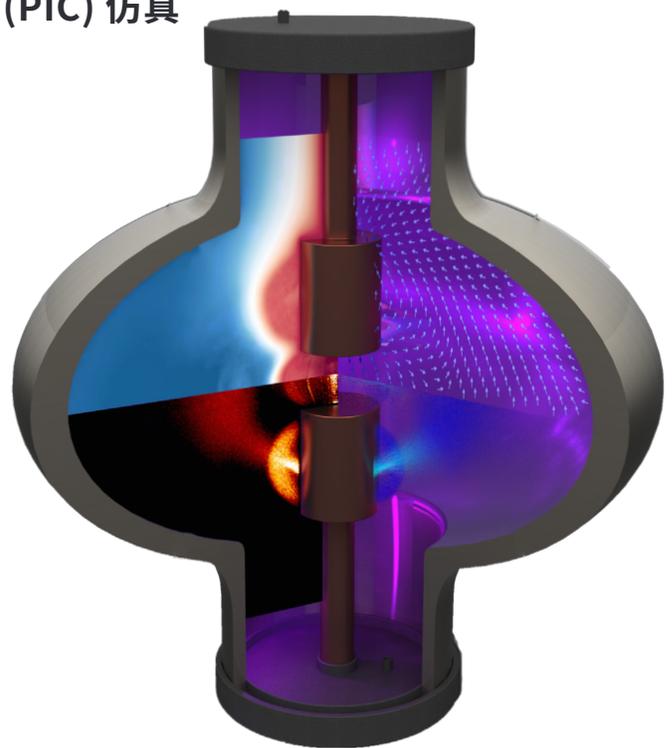


VSimPD

最全面的等离子体仿真解决方案

VSimPD 是一款多功能且功能强大的粒子式 (PIC) 仿真软体, 专为等离子体仿真优化的应用程序。VSimPD 可在任意气体压力背景下直接追踪各种动态粒子行为, 包括电子、离子和中性粒子之间弹性、激发和电离碰撞的效应。

使用 Tech-X 专有的切网格 (cut-cell) 演算法, 结合 VSim 的独特方法, 使用 FDTD 和 PIC 方法, VSimPD 可快速准确地仿真复杂粒子多维度的动态行为。强大的后处理能力可让使用者进行稳健分析, 并且由于 VSim 设计为可进行并行运算, 可以很容易将其安装在高性能计算系统。最初由 Tech-X 的科学家创建, 他们仍是等离子体和计算物理领域的主要贡献者, VSimPD 是最全面的等离子体仿真解决方案。

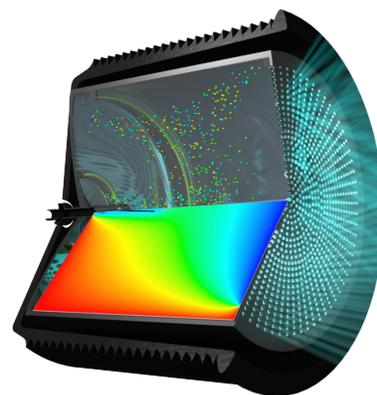


“此软件的很大一部分价值在于我们获得的技术支持和协助建立离子源模型。这让 VSim 对我们的研究非常有用。”

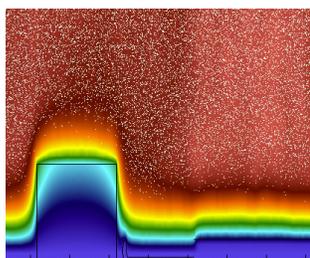
—Bruce Marsh, 欧洲核子研究中心

VSimPD 优势:

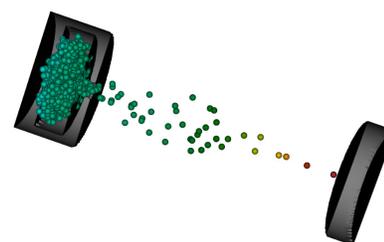
- 用于复杂仿真的 FDTD 代码
- 用于等离子体动力学仿真的 PIC 演算法
- 准二阶精度
- 全套反应类型可用于深度分析
- 强大的后处理
- 高性能计算能力
- 与所有 VSim 模组无缝整合
- 强大的文档和教程



固定式等离子推进器



等离子晶圆蚀刻



从Penning离子源中萃取离子

VSimPD 的应用

-  等离子体蚀刻
-  等离子体清洗
-  等离子体增强
化学气相沉积
-  等离子推进器
-  磁控溅镀
-  直流和射频溅镀
-  离子源
-  卫星表面充电

技术支持

许多我们的客户将我们的软件用于新颖的应用而我们训练有素的应用工程师拥有物理和工程专业知识来支援他们的需求。每个 Tech-X 软件授权购买包含了支持时数, 以便客户可以充分利用我们仿真产品的强大功能。

关于 Tech-X 公司

Tech-X 公司致力于技术卓越和创新。我们的科学家和软件工程师通力合作以提供可量化的结果。我们结合学术研究与商业软件公司的敏感度, 利用最新的硬体和软件进步发展的优势以提供高品质的尖端软件。